

「有機ケイ素NEDO特別講座」

Q単位シロキサン化合物の製造技術、 分析評価技術講座ワークショップ

日時

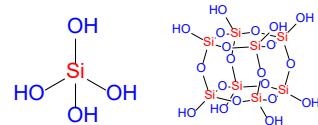
2026年3月6日(金)



13時30分～17時50分 (受付時間 13時00分～13時30分)

対象者

企業の研究者・開発者、大学教員・学生



内容
(予定)

- 13:00-13:30 受付
- 13:30-13:40 開会挨拶・趣旨説明
- 13:40-14:25 シロキサン化合物の基礎およびポリシロキサンの合成
(東京理科大学 山本一樹 講師)
- 14:25-15:10 Q単位シラノールの単離と水素結合性無機構造体(HIF)の開発
(産総研 五十嵐正安 上級主任研究員)
- 15:10-15:20 —休憩＆名刺交換—
- 15:20-16:05 アルコキシシランの加水分解反応を対象とした
反応中化学種の追跡手法の確立
(日本ウォーターズ 山田光一郎 シニアアプリケーションケミスト)
- 16:05-16:50 直鎖状ポリシロキサンのイオン化および高密度集積
(香川大学 原光生 准教授)
- 16:50-17:00 —休憩＆名刺交換—
- 17:00-17:45 防曇材料、断熱材料としてのポリシリセスキオキサンの設計と合成
(広島大学 大下淨治 教授)
- 17:45-17:50 質疑応答・閉会
- 17:50-18:10 —移動—
- 18:10-20:00 懇親会＆名刺交換会 (産総研内食堂)

お申込み

<https://forms.office.com/r/kU2Wxj6vW6>

※只今申込を受け付けています。申込締切:2026年2月27日(金)



会場

産業技術総合研究所 つくば中央事業所 第5群5-2棟 6603室
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1

お問い合わせ

産業技術総合研究所 触媒化学研究部門 五十嵐正安

Tel: 050-3521-2115

E-mail : M-silicone-kouza-ml@aist.go.jp